表面ラフネス散乱の非線形モデルにおける移動度と実効電界の 関係とユニバーサリティを説明する係数 nの解釈

Interpretation of universality of mobility against effective electric field and coefficient η based on nonlinear model of surface roughness scattering

⁰隅田 圭,トープラサートポン カシディット,竹中 充,高木 信一 (東大院工) ⁰K. Sumita, K. Toprasertpong, M. Takenaka, S. Takagi (U. Tokyo, School of Eng.) E-mail: sumita@mosfet.t.u-tokyo.ac.jp

【背景】異なる基板濃度を有する SinMOSFET の電子移動度が、実効電界に対してユニバーサルにな ることは実験的に、かつ表面ラフネス(SR)散乱の線形モデルによって理論的にもよく知られている[1]、 [2]. 一方で,実際の SR 散乱はラフネスに対して強く非線形的な散乱現象であり,線形モデルは物理的 描像とかけ離れていること、及び非線形性を考慮したモデルを我々は提案した[3]. しかしながら、SR 散乱の非線形モデルの散乱描像では移動度の実効電界に対するユニバーサリティは保証されていない. そこで本研究では、SinMOSFETのSR散乱移動度のユニバーサリティが成立する起源を明らかにした. 【理論】SR 散乱の描像と各サブバンドにおける実効電界Eeffの定義を Fig. 1 に示す.線形モデルの摂 動では、静電ポテンシャルの摂動項が実効電界に対応しているので、移動度とE_{eff}の関係は明白であ った.一方で非線形モデルでは、絶縁膜のポテンシャルに電子が衝突する摂動項が支配的である為、移 動度のE_{eff}に対する依存性は自明ではない.【**結果】**(100) Si nMOSFET における各谷の基底サブバンド の移動度を、各サブバンドの実効電界E_{eff,i}及びトータルの実効電界E_{eff,total}を横軸に Figs. 2(a), (b)にそ れぞれ示す. Eeffiによって各谷の電子の感じる三角ポテンシャル,及び波動関数の形状が決定する為, 移動度はE_{eff,i}に対してユニバーサリティが成立する.一方, E_{eff,total}に対しては各谷の移動度は基板 濃度に依存してしまう. ここで各谷の実効電界と N_sの関係を Fig. 3 に, Δ2 谷と Δ4 谷の移動ドが近い理 由を Fig. 4 に示す. 波動関数の形状を反映した Δ₂ 谷と Δ₄ 谷の係数ηはそれぞれ 0.6, 0.37 であり, 垂直 電界の遮蔽によって各谷の実効電界は変わりうる.従って、実効電界、電子占有率(Fig. 5)、移動度は全 て基板濃度に対して変化する為,SR 散乱移動度が実効電界に対してユニバーサルになる保証は原理的 には存在しない. 一方 Fig. 6 に示す通り, SR 散乱移動度は $\eta = 1/2$ とした時の実効電界でよく記述され る. これは Figs. 2(b), 4 に示すように, Δ2谷の電子による垂直電界の遮蔽により, Δ4谷の移動度が Δ2谷 に近づくことが、ユニバーサリティが偶然成立した理由であると考えられる. 【謝辞】本研究は、科学 研究費補助金 (21J10272 及び 22H00208) の支援により実施した. 【参考文献】[1] S. Takagi et al., IEEE TED 41, 2357 (1994). [2] T. Ando et al., Rev. Mod. Phys. 54, 437 (1982). [3] K. Sumita et al., IEDM, 406, 2021.

